Fine structure formed on Ge surface by ion implantation

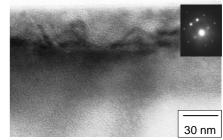
<目的>

Ge基板に室温でSn+を照射するとナノスケールの空孔集合体からなる微細構造が形成される。この実験ではGe基板に低温でSn+を照射した試料の構造形成機構をX線回折、表面SEM、断面TEMを用いて観察する。

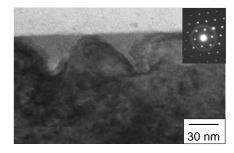
<実験方法>

Ge基板に低温(-123)でSn+イオンを加速電圧 60 k V 照射した試料を作製し、X 線、SEM、TEM で観察した。 <結果>

- ・注入量 2.0×10¹⁴ions/cm²では、歪みが観察された。
- ・注入量 4.0×10¹⁴ions/cm²では、深さ 40nm、直径 70nm の三角の形をしたものが観察された。制限視野回折像より双晶になっていることがわかるので、この三角の部分が双晶領域である可能性が高い。
- ・それぞれの試料で非晶質は観察されなかった。



 $2.0\times10^{14}ions/cm^2$



 $4.0 \times 10^{14} ions/cm^2$